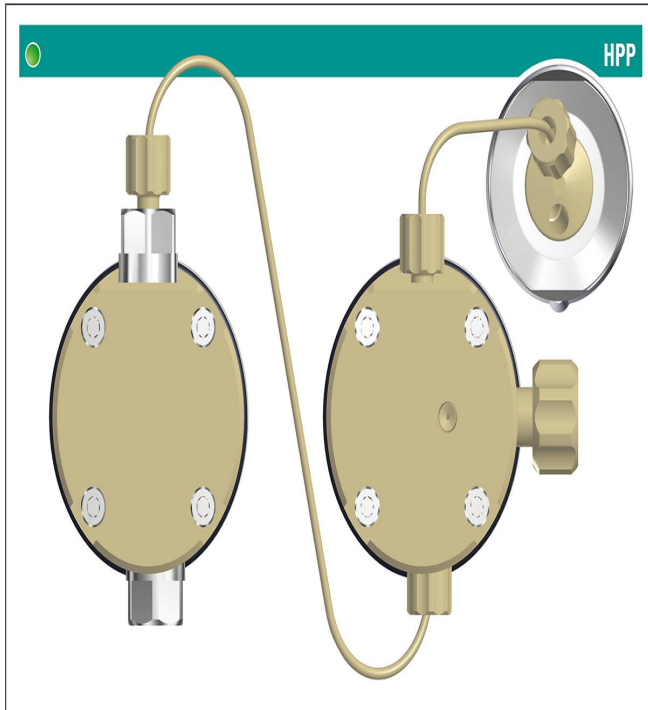




OMNIS High-Pressure Pump Unit

2.1056.0210

L'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit è una pompa ad alta pressione avanzata, resistente agli agenti chimici, progettata per la cromatografia ionica.

È dotata di un sistema di erogazione degli eluenti controllato a pulsazioni, in cui il volume erogato viene compensato automaticamente, eliminando la necessità di ulteriori smorzatori di pulsazioni. La corsa viene ottimizzata dinamicamente in base alle condizioni operative, assicurando prestazioni ottimali. Due singoli drive sincronizzati consentono un controllo preciso e portate costanti. Il pistone è collegato all'azionamento anziché alla testa della pompa, il che migliora la stabilità e semplifica la manutenzione. Il percorso del flusso è privo di metalli e chimicamente inerte, garantendo la massima compatibilità con i fluidi aggressivi. Inoltre, la pompa è resistente a sostanze con un ampio intervallo di pH compreso tra 0 e 14, rendendola adatta a un ampio spettro di applicazioni.

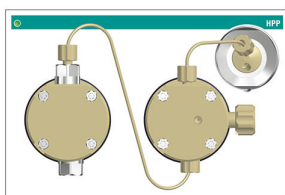
L'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit può essere dotata opzionalmente di un sistema di lavaggio delle guarnizioni dei pistoni per prevenire la cristallizzazione e ridurre al minimo la manutenzione. L'OMNIS High-Pressure Pump Unit include una valvola di spurgo manuale. Se nell'OMNIS IC System è installato un iniettore 7/3, il processo di spurgo può essere completamente automatizzato.

Specifiche:

- Intervallo di pressione: 0 – 42 MPa
- Intervallo di flusso: 0,0001 -10,000 mL/min
- Precisione di flusso: 0,1%
- Riproducibilità del flusso: 0,1%
- Pulsazione: 0,1%
- Materiale della testa della pompa: PEEK

Parti incluse 2.1056.0210

Order Number	Descrizione	Quantità
1.1056.0210	OMNIS High-Pressure Pump Unit La OMNIS IC High-Pressure Pump Unit è una pompa ad alta pressione avanzata, resistente agli agenti chimici, progettata specificamente per la cromatografia ionica. È dotata di un'erogazione degli eluenti a pulsazioni controllate, grazie al quale il volume erogato viene compensato automaticamente, eliminando la necessità di ulteriori smorzatori di pulsazioni. La corsa viene ottimizzata in modo dinamico in base alle condizioni di funzionamento, assicurando prestazioni ottimali. Due singoli azionamenti sincronizzati consentono un controllo preciso e flussi continui. Il pistone è collegato all'azionamento anziché alla testata della pompa, il che migliora la stabilità e semplifica la manutenzione. Il percorso del flusso è privo di metallo e chimicamente inerte, garantendo la massima compatibilità con i fluidi aggressivi. Inoltre, la pompa è resistente alle sostanze in un ampio intervallo di pH, compreso tra 0 e 14, il che la rende adatta a un'ampia gamma di applicazioni. Opzionalmente, la OMNIS IC High-Pressure Pump Unit può essere dotata di un lavaggio guarnizioni del pistone per evitare la cristallizzazione e ridurre al minimo la manutenzione. La OMNIS High-Pressure Pump Unit include una valvola di spurgo manuale. Se nel sistema OMNIS IC viene installato un iniettore 7/3, il processo di spurgo può essere completamente automatizzato.	1 PCS



6.01831.110

Capillare in PEEK HPP - INJ, 160/0,5 mm

1 PCS

Capillare in PEEK pretagliato con etichetta per OMNIS IC



Accessori opzionali

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



6.2821.120

Filtri in linea 2 µm

Filtri in linea 2 µm



6.02621.010

Multitool, HPP

Strumento multifunzione per la manutenzione della OMNIS High-Pressure Pump Unit.



6.02741.000

**Guarnizione del pistone, PE,
arancione**

Guarnizione del pistone per OMNIS IC High-Pressure Pump Unit.



6.02741.030

**Set di manutenzione,
guarnizione per lavaggio del
pistone, 2 pz.**

Set di manutenzione per lavaggio guarnizioni del pistone dell'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit.



6.02824.000

**Pistone per pompe, ZrO₂, 3,8
mm**

Pistone per pompe per l'OMNIS IC High Pressure Pump.



6.02824.010

**Valvola unidirezionale di
entrata, PEEK**

Valvola unidirezionale priva di metalli per il lato in uscita dell'OMNIS IC High Pressure Pump Unit.



6.02824.020

**Valvola unidirezionale di
uscita, PEEK**

Valvola unidirezionale priva di metalli per il lato in uscita dell'OMNIS High-Pressure Pump Unit.



6.05332.020

**Equipaggiamento OMNIS IC:
lavaggio guarnizioni del
pistone HPP, DD**

Set di accessori per il lavaggio guarnizioni del pistone HPP: il lavaggio guarnizioni del pistone HPP per l'OMNIS IC HPP è dotato di serie di una porta libera su un sistema di dosaggio integrato nell'OMNIS Cylinder Unit. Dopo ogni analisi del campione, il pistone viene sciacquato con una piccola quantità di acqua ultrapura.

Quando non è disponibile alcun canale libero sulla Cylinder Unit, l'acqua ultrapura può, in alternativa, essere trasferita tramite un canale della pompa peristaltica dotato di tubo della pompa peristaltica 601826010.

Prerequisiti:

OMNIS IC S/M/L, comprendente:

- porta disponibile dell'OMNIS Cylinder Unit (con acqua ultrapura come reagente di lavoro) oppure
- canale OMNIS Peristaltic Pump Unit disponibile



6.05801.010

Kit per lavaggio pistoni



Upgrade kit per dotare la OMNIS High-Pressure Pump Unit del lavaggio pistoni. Le guarnizioni per lavaggio pistoni sono incluse.

Prerequisiti:

- 2.1056.0210 OMNIS High-Pressure Pump Unit
- 6.02621.010 Multitool, HPP